前言

肖特提供均匀性高达 H5 的深加工光学玻璃。I 线玻璃甚至可以提供更高的均匀性等级。可达到的均匀性主要取决于玻璃类型和尺寸。有一系列均匀性 H4 或更高的玻璃能够现货供应。

例如,肖特 N-BK7[®] 玻璃具有高均匀性,可大量生产均匀性为 H4 和更高的200毫米以上的尺寸。

1. 均匀性的定义
2. 整体不均匀性的产生1
3. 均匀性等级
4. 测量设备
5. 均匀性测量方法
6. 测量精度
7. 检验证书和测量结果说明
8. 材料选择/含义8
9.结论
0. 文献 11

1. 均匀性的定义

光学玻璃最重要的特性之一是材料折射率的空间均匀性极好。一般来 讲,可以区分材料折射率的整体和大范围均匀性以及玻璃均匀性的小范 围偏离。条纹是玻璃均匀性在空间上小范围的变化。小范围变化是指大 约0.1到2毫米的距离上的变化(有关条纹的更多信息请参阅 TIE-25), 而空间上大范围的整体折射率均匀性涉及到整个玻璃件。

2. 整体不均匀性的产生

整体不均匀性的产生主要有3个原因:

 熔炼工艺:光学玻璃主要采用连续熔炼工艺生产。熔炼过程中化学组 分的梯度会导致折射率的不均匀性。梯度产生的原因是特定组分的表 面挥发和/或与模具壁材料接触的熔体部分发生反应。为了在连续熔 炼和浇铸过程中进行工艺控制,折射率被描述为时间的函数。在不同 的时间通过浇铸获得的具有最高均匀性的玻璃,其折射率在时间上几 乎保持不变。 • 热平衡导致的密度变化:

1

热力平衡会引起玻璃密度的变化。在较高温度下达到平衡密度的时间 比较低温度下的短。在转变温度 Tg 附近,不同温度达到的平衡密度是 不同的。折射率均匀性是玻璃中密度分布的函数。接近 Tg 时,不受控 制的玻璃冷却过程会产生折射率的空间不均匀性。在光学玻璃生产过 程中,后续的精密退火可防止这种不均匀性。

玻璃必须从略高于 Tg 的温度开始缓慢冷却,以防止形成热 梯度。对大尺寸光学玻璃进行精密退火以达到高均匀性是 一个非常耗时的过程。

• 冷却过程中温度梯度导致的永久应力。





肖特 均匀性等级	ISO 10110 第4部分均匀性等 级	最大折射率偏差,按 照 ISO 10110 第4部 分	最大折射率偏差 按照 ISO 12123 和肖特光学玻 璃目录	适用性
SO	0	$\pm 50 \cdot 10^{-6}$		偏差公差,单个切割件的均匀 性始终更好
S1	1	± 20 · 10 ⁻⁶		偏差公差 适用于单个切割件
H1		$\pm 20 \cdot 10^{-6}$	$40 \cdot 10^{-6}$	适用于单个切割件
H2	2	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$	10 · 10 ⁻⁶	适用于单个切割件
H3	3	$\pm 2 \cdot 10^{-6}$	4 · 10 ⁻⁶	适用于单个切割件
H4	4	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$	2 · 10 ⁻⁶	适用于单个切割件,不适用所 有尺寸,不适用所有玻璃类型
Н5	5	$\pm 0.5 \cdot 10^{-6}$	1 · 10 ⁻⁶	适用于单个切割件,不适用所 有尺寸,不适用所有玻璃类型

表1:均匀性等级。

3. 均匀性等级

根据 ISO 标准 10110 第4部分 [5],具有更高折射率均匀性要求的玻璃 可分为5个等级。单个玻璃件的肖特均匀性等级 H1 至 H5 包含 ISO 等 级1至5。肖特使用 ISO 标准中的0级和1级来描述偏差公差。 偏差公差是玻璃件之间的折射率偏差 [4]。ISO 12123 用峰谷值表示最 大折射率偏差。最新的光学玻璃目录 [6] 使用这个定义。光学玻璃所需 的均匀性应根据具体应用和光学元件的最终尺寸来确定。这个数值被定 义为所需测量光阑内折射率(例如物理尺寸的95%)内的最大偏差。

根据光学元件的体积、玻璃类型和毛坯玻璃尺寸的不同,对单个切割件 进行测量。直径达500毫米的玻璃件可使用现有的菲索干涉仪测量。直 径达1500毫米的玻璃件可在直径最大500毫米的子孔径中测量。然后 用拼接软件合并单个测量。可以为单个切割件提供干涉图。

表1列出了适用的均匀性等级。

根据下式,光学元件内的折射率偏差会导致通过玻璃件时波前畸变:

 $\Delta s = d \cdot \Delta n$

 Δs 为波前偏差,d为玻璃厚度, Δn 为玻璃中折射率偏差峰谷值。例如: 一个平面波穿过50毫米厚的 H2 级平面玻璃件,最大畸变为 50 mm · 10 · 10⁻⁶ = 500 nm。通过相同厚度的 H5 级玻璃件导致的 最大波前畸变为50 nm。



SCHOTT 凝智慧 享未来 肖特科技

4. 测量设备

由于基于干涉的积分方法可以直接测量入射波前畸变,因此这种方法是 用于均匀性评估的测量方法的首选,尤其是相位测量干涉法。通过对玻 璃样本中的光路进行积分来评估均匀性。因此,无法检测光束方向上的 折射率线性梯度。为了抑制表面的不规则性,玻璃样本要么放在两块油 板之间并通过浸油接触,要么经过抛光并在不同方向上测量,以消除表 面影响。肖特使用这两种方法。

肖特在美因茨使用两台蔡司的 DIRECT100 菲索干涉仪进行均匀性测量,采用最大孔径508毫米(20英寸)和300毫米(12英寸)肖特北美公司在杜里埃使用 Zygo 干涉仪可通过600毫米孔径进行测量。图1为 DIRECT100 布置示意图。



图1:干涉仪布置示意图。

该装置由一个氦氖激光光源和一个大准直透镜组成,后者将激光束转变 为全孔径。准直后的平行光束穿过部分反射的参考平板。部分光线被参 考平板反射回来。剩余光线进入空腔,第一次穿过样本。穿过样本后,光 线被一个平面镜反射回来,第二次穿过样本、参考平板和准直镜,然后 在 CCD 阵列上与参考平板反射回来的光线发生干涉,干涉条纹被记录 下来。 参考平板(F)和自动准直镜(A)都用 ZERODUR[®] 制造。干涉仪采用卡尔 蔡司 [1] 的直接测量干涉法。该方法能够实时提供干涉图以及从干涉条 纹计算得到的波前畸变。2毫秒即可得到一次干涉图数据。 40毫秒后可得到完整的波前数据集。因此,不到3分钟就可对4000个波 前数据集计算平均值。

玻璃的折射率偏差取决于热光系数引起的温度。因此,玻璃内的温度梯 度会影响测量精度。必须采取特殊措施来减少样本内的温度变化。干涉 仪的房间装有空调。一个特殊的隔室将干涉仪空腔与干涉仪的房间分开。 (见图2)。这个隔室的温度稳定性为±0.05°C,隔室周围空间的温度稳 定性为±0.25°C。一个特殊的传送系统将制备好的样本送入干涉仪空 腔中。



图2: 12英寸 DIRECT100, 机械手将样本 放入空腔。





5. 均匀性测量方法

测量均匀性时,必须消除样本表面的影响。肖特使用两种方法进行均匀 性测量:"油板夹层"方法和"抛光样本"方法。



图3:油板夹层测量方法的布置。

使用"油板夹层"方法时,将样本放在两块玻璃板之间(图3中的 S1和 S2)。 这两块玻璃板的表面经过精确抛光。玻璃板通过浸油(O)与样本接触,浸 油的折射率与样本相同。使用这个测量方法时样本(G)无需抛光。只要求 研磨表面的平面度约为2微米。测量时,首先测量不带样本时的油板 (W1),然后减去带样本的油板的测量值(W2)。

这个结果就构成样本的均匀性图。浸油与样本的折射率必须非常匹配 (Δn 应小于 1·10⁻⁴),这一点对于这个方法达到高测量精度非常重要。 要测量具有不同折射率的很多不同的光学玻璃时,可使用三种浸油混合物。使用"油板夹层"方法可以测量折射率从1.473至1.651的光学玻璃。







图4: 抛光样本测量方法。

对于无法使用"油板夹层"方法测量的光学玻璃,必须使用"抛光样本"方法[3]。使用这个方法时,必须对样本两面抛光,使其达到适度的光学质量。此外,上下表面之间必须做出几个角分的小斜面。均匀性测量由先

后4次测量组成(见图4)。首先需要测量空腔。然后测量3次样本。分别在 光线穿过时、从背面反射以及从正面反射时测量样本。然后将这4个测量 值合并,评估均匀性分布。





6. 测量精度

如前所述,光学玻璃的均匀性是通过用干涉法评估波前变化来测量的。 因此,干涉仪的测量精度以纳米波前偏差(峰谷值)表示。

干涉仪的精确度可通过空腔的可重复性测量来评估。可重复性在 3-4 纳米峰谷值的范围内,即所谓的干涉仪的"噪声"。 波前测量的总精确度受到温度均匀性、浸油折射率的匹配准确度以及准 备工作(油板夹层测量布置,为抛光方法制备样本)等因素的影响。

油板夹层测量方法的标准差在±10纳米波前偏差(峰谷值)范围内。

 ± 10 纳米波前精确度的实际含义是,测量均匀性等级 H5 ($\pm 5 \cdot 10^{-7}$) 时,样本厚度至少需要达到 10-20 毫米。测量的灵敏度随着样本厚度的增加而提高。

7. 检验证书和测量结果说明

对于每次均匀性测量,客户都可获得均匀性检验证书。对于使用 DIRECT100的测量,检验证书中包含被测样本的均匀性图。这个带有 颜色编码的均匀性图表示了测量孔径内的折射率变化。不同颜色代表不 同的折射率值。因此,颜色变化代表了折射率偏差,也就是代表了不均匀。在这个均匀性图中,均匀性表示为峰谷值变化。图5表示了沿着色图中箭头方向的典型的均匀性分布颜色图和一维"高度"图。



图5: 2D 均匀性颜色图和沿箭头方向的一维图形。





技术信息 先进光学

TIE-26 光学玻璃的均匀性

波前畸变的形状(以及均匀性分布)可在数学上被描述为若干独立像差项之和的多项式函数。这些像差项包含表示焦点、像散、彗差和波前内球面像差的系数。平移偏差和倾斜偏差会提前从波前中减去。肖特使用泽尼克多项式展开对波前进行分解[2]。

对于某些应用,了解泽尼克系数以模拟光学装置中元件引起的波前畸变 非常重要,因此,肖特圆形孔径均匀性检验证书中包含关于泽尼克系数 的信息。

只有当给定的波前具有圆形孔径时,对其进行泽尼克多项式展开才有效。





图6:泽尼克多项式展开示例。

在大多数光学玻璃应用中,可在透镜设计中补偿焦点项,也就是通过调 节透镜距离来重新对焦。在大多数情况下,从整个波前减去焦点项后的 峰谷值均匀性远低于初始值(见图7)。



图7:肖特 N-BK7[®] 坯件,带和不带焦点像差。



8. 材料选择/含义

从熔炼过程中选择均匀材料有若干种标准。熔炼过程中折射率与时间的 关系图可用于评估所生产的玻璃是否具有更高的均匀性。最佳结果是折 射率随时间保持恒定,这意味着要达到高均匀性,应从图中曲线斜率接 近零的区域取出玻璃。 选择高均匀性玻璃的另一个标准是条纹检测。一般来说,整体高度均匀 的玻璃中没有条纹。图8a表示了无条纹 N-BAK1 玻璃块的均匀性测量, 图8b表示了来自同一熔体的有条纹 N-BAK1 玻璃块的均匀性测量。 无条纹玻璃块的均匀性比有条纹的好两倍。DIRECT100 干涉仪的空间 分辨率不够高,无法呈现出条纹本身。



图8:条纹数量是均匀玻璃的选择标准。

无论玻璃规格是圆形还是块状,大多数均匀性分布都表现出旋转对称性。 因此,如果通过切割和研磨来减小大型铸件的直径,均匀性就会增加。

图9表示了圆盘形肖特 N-BK7[®] 玻璃件(起始直径260毫米)的均匀性, 均匀性是直径的函数。玻璃圆盘直径260毫米时均匀性为 H2 级,250毫 米时为 H3,210毫米时为 H4,170毫米时为 H5。一般来说,可以观察 到均匀性随直径的减小而增加。



图9: 均匀性是直径的函数。

SCHOTT ^{凝智慧 享未来}肖特科技

玻璃圆盘边缘附近存在最大的均匀性偏差。均匀性在模具壁方向上减小 的原因可能在于浇铸工艺。浇铸过程中的玻璃流动形成特定的对流模 式。坩埚从下往上、从内向外被逐渐填充。填充坩埚所需的时间里,折射 率的轻微变化会反映在后来的折射率分布中。 这种现象尤其是在大块坯件的生产过程中会产生影响。与耐火坩埚壁材 料发生的其他反应会降低玻璃外部区域的均匀性。

图10表示了直径840毫米的肖特 N-BK7[®] 圆盘的均匀性测量结果。在 464毫米孔径内达到了H4 级质量。



图10: 直径840毫米的肖特 N-BK7® 圆盘的均匀性。

在均匀性测量中,浇铸过程中熔体折射率的微小差异在边/边方向上比 在顶/底方向上更显著。图11表示了肖特 N-BK7[®] 玻璃块的顶/底和边/ 边方向上的均匀性分布。边/边方向上的均匀性低于顶/底方向上的均匀 性。这一观察对于为极高质量的棱镜应用选择材料可能很重要。







图11:均匀性取决于观察方向。

可达到的均匀性还在很大程度上取决于玻璃类型和生产工艺。肖特可现 货提供多种高均匀性的精密退火切割件光学玻璃。 至少直径的90%都能达到指定的均匀性。对于更小的直径,也可以按要 求提供更高的均匀性。

表2概括列出了可提供的玻璃类型、尺寸和均匀性等级。

肖特 N-BK7[®] 和 F2 可为棱镜应用提供,会在两个相互垂直的方向上进 行均匀性检查。

玻璃类型*	供应规格*	最大可提供尺寸*	均匀性等级
F2	圆盘	Ø 290 mm, 厚度: 100 mm	H4
LF5	圆盘	Ø 220 mm, 厚度: 45 mm	H4
LLF1	圆盘	Ø 220 mm, 厚度: 45 mm	H4
肖特 N-BK7 [®]	块状	400 mm x 400 mm x 70 mm	H4
	块状	250 mm x 250 mm x 100 mm	H4
N-FK5	圆盘	Ø 240 mm, 厚度: 50 mm	H4
N-FK51A	圆盘	Ø 200 mm, 厚度: 40 mm	H4
N-KZFS11	圆盘	Ø 170 mm, 厚度: 40 mm	H4
N-LAK22	圆盘	Ø 200 mm, 厚度: 50 mm	H4
SF5	块状	150 mm x 150 mm x 60 mm	H4

*可根据要求提供其他玻璃类型、供应规格和尺寸(尺寸取决于玻璃类型)。



 SCHOTT

 凝智慧 享未来 肖特科技

9. 结论

一般来说,光学玻璃的整体折射率均匀性优于 40.10-6 (包括 ISO 10110 第4部分均匀性等级1)。

大多数深加工光学玻璃的均匀性可以达到 H2 或更好。肖特可以提供均 匀性高达 H5 的光学玻璃。可达到的均匀性取决于玻璃类型和尺寸。对 于特殊应用,肖特还可以提供在两个相互垂直方向上的高度均匀性。

10. 文献

- [1] The new ZEISS Interferometer, 72 Proceedings of SPIE's Int. Symposium on Optical and Optoelectronic Applied Science and Engineering, Küchel, M., San Diego, paper 1332, 1990
- [2] Interferogram analysis for optical testing, Malacara, D., Servin, M.; Malacara, Z.: Marcel Dekker Inc., 1998
- [3] Homogeneity testing by phase sampling interferometry, Schwider, J., Appl. Opt. 24, pp. 3059-3061, 1985

- [4] SCHOTT Optical Glass Pocket Catalogue
- [5] ISO/DIS 10110 part 4; Preparation of drawings for optical elements and systems; Material imperfections -Inhomogeneity and striae, 1994
- [6] ISO 12123 Specification of raw optical glass, 2010

2023年8月版



更多相关信息请联系:

schott.com

凝智慧 享未来 肖特科技